DOCKET NO.: 15675P550

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re the Application of:	1
Ana Lacoste, et al.	Art Group:
Application No.:	Examiner:
Filed:	
For: device for confinement of a plasm within a volume	na
Commissioner for Patents P.O, Box 1450 Alexandria, VA 22313-1450	
REQUES	T FOR PRIORITY
Sir:	
Applicant respectfully requests a	convention priority for the above-captioned
	LICATION
000111111	UMBER DATE OF FILING 203900 28 March 2002
☐ A certified copy of the documer	
	Respectfully submitted,
Dated: $4(27/29)$	Blakely, Sokoloff, Taylor & Zafman LLP Fric S. Hyman Meg. No. 30 139
12400 Wilshire Boulevard, 7th Floor Los Angeles, CA 90025 Telephone: (310) 207-3800	Eric S. Hyman Reg. No. 30,139



PCT/R 03/00634

REC'D 2 6 MAY 2003

WIPO PCT

BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ - CERTIFICAT D'ADDITION

COPIE OFFICIELLE

Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que le document ci-annexé est la copie certifiée conforme d'une demande de titre de propriété industrielle déposée à l'Institut.

Fait à Paris, le 18 FEV. 2003

Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Le Chef du Département des brevets

Martine PLANCHE

DOCUMENT DE PRIORITÉ

PRÉSENTÉ OU TRANSMIS CONFORMÉMENT À LA RÈGLE 17.1.a) OU b)

Best Available Copy

NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE SIEGE 26 bls, rue de Saint Petersbourg 75800 PARIS cedex 08 Téléphone : 33 (0)1 53 04 53 04 Télécopie : 33 (0)1 53 04 45 23 www.inpl.fr



CERTIFICAT D'UTILITÉ



Code de la propriété intellectuelle - Livre VI

26 bls, rue de Saint Pétersbourg 75800 Paris Cedex 08 Téléphone : 33 (1) 53 04 53 04 Télécopie : 33 (1) 42 94 86 54

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE page 1/2

المستحثا
GD 19
20
F35, 4,4

- Live A A It	Réservé à l'INPI	C	et imprimé est à remplir	isiblement à l'encre noire DB 540 W /3	00301
REMISE DES PIÈCES DATE LIEU 28 M	ARS 2002			DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE SPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSEE	
CIEO	I PARIS	1	~		- 1
N° D'ENREGISTREMENT				EGIMBEAU	ł
NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L	. _{INPI} 0203900	"	20, rue de Chazelles		- 1
DATE DE DÉPÔT ATTRIBUÉ	E·		75847 PAI	US CEDEX 17	- 1
PAR L'INPI	2 8 MARS 7	002	FRANCE		- [
Vos références po	our ce dossier		n .		
(facultatif) 23952	21 D19889 AV				
	n dépôt par télécopie	☐ N° attribué par l'INPI à la télécopie			
MATURE DE L	A DÉMANDE	Cochez l'une des 4 cases sulvantes			
Demande de b	prevet	×			1
Demande de c	ertificat d'utilité			to go that a more made or the same processor. I have a same a take the managed and a quantum and a	
Demande divis	sionnaire				
	Demande de brevet initiale	N°	D	ate L: L L L L L L L L L L L L L L L L L L	- [
ou demai	nde de certificat d'utilité initiale	N°	D	ate	
Transformation	d'une demande de		- market	The state of the s	
brevet européer	n Demande de brevet initiale	N°	D	ate Lili	
		Pour ou organization		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	N DE PRIORITÉ : DU BÉNÉFICE DE	Pays ou organisation Date		1°	
	DÉPÔT D'UNE	Pays ou organisation		10	
1		<u> </u>			ı
DEMARDE A	NTÉRIEURE FRANÇAISE	Pays ou organisation Date		10	1
		S'il y a d'aut	autres priorités, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»		
E DEMANDEUR		S'il y a d'auti	res demandeurs, coch	ez la case et utilisez l'imprime «Suite	4
Nom ou dénor	mination sociale				
Prénoms	<u>.</u> .	CENTRE NATION	NAL DE LA RECHER	CHE SCIENTIFIQUE (CNRS)	4
Forme juridiqu	ie	ETADI ICCCACENT	C DUDI IO A CADAC		7
N° SIREN	,	ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE SCIENTIFIQUE ET TECHNO		····	
Code APE-NAF	F	\\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	·		
Adresse	Rue	3, rue Michel Ange	e, 75016 PARIS		
Valesse	Code postal et ville				
	Pays	FRANCE		The second of th	
Nationalité		Française			
M	N° de téléphone (facultatif)				
	N° de télécopie (facultatif)				
Adresse électr	onique (facultatif)	THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR			



BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'E-LITÉ

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE page 2/2





	Réservé à l'INPI			
75 INPI N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL ATTRIBUÈ PAR L'I	ARS 2002 PARIS 0203900			D8 540 W /300301
Vos références po (facultatif)	ur ce dossier :	239521 AV		
(a) MANDATAINE				
Nom				
Prénom			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
Cabinet ou Soc	ciétě	Cabinet REGIME	BEAU	
N °de pouvoir	permanent et/ou			7
de lien contrac				Company of the first of the control
Adresse	Rue	20, rue de Chaze	lles	
,	Code postal et ville	L 75847 PAR	IS CEDEX 17	_
N° de télépho		01 44 29 35 00		
N° de télécopi		01 44 29 35 99		
Adresse électr	ronique (facultatif)	info@regimbeau	fr	
MISTRESHED IN	(S)			
Les inventeurs	s sont les demandeurs	☐ Oui 努 Non Dans	ce cas fournir une désigna	ition d'inventeur(s) séparée
8 RAPPORT D	E RECHERCHE		ur une demande de brevet	(y compris division et transformation)
	Établissement immédia			
	ou établissement différe		Amounta unique	nt pour les personnes physiques
			eux versements, amqueme	in post 150 pass
Palement éch	helonnė de la redevance	Oui		
		Non	ur les personnes physique	S
RÉDUCTION	DU TAUX	Uniquement po	la première fois pour cette il	nvention (joindre un aris de non-imposition)
DES REDEV	ANCES	C Requise pour	rieurement à ce dépôt (inine	tre une copie de la décision d'admission
		pour cette in	vention ou indiquer sa référenc	e):
Si yous ave	z utilisé l'imprimé «Suite»,			
indiquez le	nombre de pages jointes			
				VISA DE LA PRÉFECTURE
50 SIGNATURE	E DU DEMANDEUR	- -		ON DE LA PREFECTORE
OU DU MAI	NDATATRE_			
(Nom et qu	ialité du signataire)			C MARTIN
	1: /(
	1//	92-1001		1/1
	' /			

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites à ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de l'INPI.

DISPOSITIF DE CONFINEMENT D'UN PLASMA DANS UN VOLUME

DOMAINE TECHNIQUE GENERAL.

La présente invention concerne le domaine technique général des plasmas, depuis les plus basses pressions (10⁻⁶ torr ou moins) jusqu'aux pressions de l'ordre de 10⁻² torr.

Plus précisément, l'invention concerne le confinement complet ou partiel d'un plasma dans un volume, et notamment le confinement dans de grands volumes de plasmas uniformes à basses et très basses pressions.

Elles trouvent notamment avantageusement application dans toutes les techniques qui nécessitent d'une part la production d'un plasma dense et uniforme, et d'autre part le confinement de ce plasma uniforme dans une enceinte par exemple dans laquelle se déroule l'application.

On rappelle qu'un plasma est un milieu gazeux, conducteur, constitué d'électrons, d'ions et de particules neutres, macroscopiquement neutre électriquement. Un plasma est obtenu à l'aide d'un champ électrique, par ionisation d'un gaz par les électrons accélérés dans ce champ électrique.

On peut pour certaines applications souhaiter confiner un plasma dans le volume d'une enceinte.

Le confinement des plasmas dans un volume peut être effectué par des aimants permanents.

Dans ce cas, le confinement est généralement réalisé en plaçant à la périphérie du volume de confinement - à l'intérieur ou à l'extérieur des parois de l'enceinte - des aimants permanents présentant au plasma des polarités nord et sud alternées. La périphérie de l'enceinte est dont soumise à un champ magnétique. On appelle cette technique le « confinement magnétique multipolaire ».

Le principe de confinement multipolaire des particules « espèces chargées » formant le plasma est le suivant.

Les particules chargées du plasma se déplacent dans l'enceinte entre des régions périphériques soumises au champ magnétique formé par

15

5

10

20

25

30

2

les aimants permanents et des régions centrales non soumises audit champ.

Les particules chargées rentrant dans la région d'influence d'un champ magnétique multipolaire sont soumises à trois principaux mécanismes.

5

10

15

20

25

30

1/ mécanisme 1. Les particules chargées issues d'une région exempte de champ magnétique peuvent être réfléchies sur et par le champ magnétique et retournent dans la région non soumise au champ magnétique;

2/ mécanisme 2. Les particules chargées issues d'une région exempte de champ magnétique franchissent en totalité la région de champ magnétique, lorsque leur trajectoire est presque parallèle aux lignes de champ magnétique.

Les particules chargées qui sont soumises au mécanisme 2 sont perdues pour le plasma. Ces particules arrivent d'une région exempte de champ magnétique pour aller vers des régions de convergence des lignes de champ magnétique, c'est-à-dire, soit directement sur les pôles magnétiques des aimants - là où l'intensité magnétique est maximale - , soit entre deux aimants de même polarité, où l'intensité magnétique est minimale et nulle. Les trajectoires des particules chargées sont alors parallèles au champ magnétique. Dans le cas où les pôles des aimants sont situés sur les parois de l'enceinte, les particules passant dans cette zone iront par exemple percuter les parois de l'enceinte. C'est le cas notamment pour les zones situées entre deux aimants unitaires avec des polarités alternées.

Les zones de convergences des lignes de champ magnétique sont appelées « festons ».

3/ mécanisme 3. Il s'agit d'un piégeage des particules chargées dans le champ magnétique multipolaire par mécanisme collisionnel.

La figure 1 montre qu'une fois piégés dans le champ magnétique, et dans un intervalle entre deux collisions élastiques ou inélastiques, les électrons énergiques oscillent entre deux lignes de champ magnétique et deux points miroirs M, où l'intensité du champ magnétique est identique.

Ces points miroirs M sont situés face à deux pôles magnétiques opposés du même aimant ou de deux aimants adjacents.

Les électrons énergiques qui produisent le plasma, appelés électrons rapides ou primaires, sont peu sensibles au champ électrique auto-consistant produit par la charge d'espace du plasma.

Au contraire, les ions et les électrons peu énergiques du plasma, encore appelés électrons lents ou thermiques, oscillent eux aussi entre deux pôles magnétiques opposés, mais ils sont en outre sensibles au champ électrique auto-consistant produit par la charge d'espace du plasma. Par conséquent, ils diffusent ensuite dans le champ magnétique de façon collective sous l'influence de ce champ électrique, de préférence vers les zones de champ magnétique faible ou nul.

Enfin, en dehors de ces mouvements d'oscillation et de diffusion, les particules chargées dérivent le long ou autour des aimants permanents, perpendiculairement au plan qui contient les vecteurs « champ magnétique » générés par la structure magnétique. C'est pour cette raison qu'il est préférable de fermer sur elle-même les structures de champ magnétique afin d'éviter les pertes de particules chargées aux extrémités des structures magnétiques. On obtient alors une structure de type 20 « magnétron ».

ETAT DE LA TECHNIQUE.

10

15

25

30

Plusieurs géométries d'alternances de polarités sont possibles pour un confinement multipolaire.

Une première géométrie classiquement utilisée est représentée à la figure 2. Une telle structure multipolaire est appelée « structure continue en ligne ». En effet, elle présente au plasma une alternance de lignes continues d'aimants permanents 3. Sur la figure 2, l'alternance de polarité se fait selon une direction que l'on référencera par 2. Les lignes continues de polarité s'étendent selon une direction référencée par 1, cette direction étant perpendiculaire à la direction d'alternance 2.

Une autre géométrie possible est représentée à la figure 3. C'est la structure « en échiquier », qui présente une alternance discontinue selon 4

les deux directions 1 et 2. Les aimants ne sont plus disposés en lignes continues, chaque aimant a une polarité différente de ses voisins selon les directions 1 et 2.

Une troisième géométrie possible est représentée à la figure 4. Elle représente l'alternance « en ligne interrompue ». Cette structure reprend le schéma de principe de la structure de la figure 2, mais les aimants des lignes de polarités sont espacés les uns des autres.

5

10

15

25

30

Les publications de R. Limpaecher et K.R. MacKenzie, Rev. Sci. Instrum., vol. 44, p. 726-731 (1973), et K.N. Leung, T.K. Samec, et A. Lamm, Phys. Lett., vol. 51 A, p. 490-492 (1975), divulguent des dispositifs de confinement utilisant les structures décrites sur les figures 2 à 4.

Dans ces dispositifs, les aimants permanents sont disposés à l'intérieur ou à l'extérieur de l'enceinte de confinement, mais les aimants ont toujours un des pôles de chaque aimant situé sur une paroi de l'enceinte.

La figure 5 représente schématiquement une coupe transversale d'un exemple de dispositif divulgué dans lesdites publications. Il comporte une enceinte 10 comportant une paroi 2, un plasma 5 confiné dans l'enceinte 10 grâce à l'action d'aimants permanents 3. Dans cet exemple, les aimants sont situés à l'extérieur de l'enceinte, mais on aperçoit qu'au moins un pôle de chaque aimant 3 est sur la paroi 2. Des lignes de champ 20 magnétique sont représentées schématiquement par les arcs de cercle 6 et 7. Les lignes d'aimantation 7 se rebouclent sur elles-mêmes et interceptent la paroi 2.

Les différentes structures d'aimants peuvent être mises en œuvre sur le dispositif de la figure 5. On peut par exemple mettre en œuvre les structures des figures 2 à 4 selon la direction 1 représentée sur la figure 5. La direction 1 est alors perpendiculaire au plan de la figure.

On peut également mettre en œuvre les structures selon l'autre direction, à savoir que la direction 1 est dans le plan transversal de l'enceinte, comme représenté sur la figure 6 avec comme exemple la structure de la figure 2.

Un premier mode de réalisation selon les figures 5 ou 6 met en œuvre une structure selon la figure 2. En faisant référence à la figure 2, on comprend qu'aucune ligne de champ magnétique 7 d'un aimant permanent ne se reboucle selon la direction 1 sur la face arrière du même aimant, puisque la structure est continue selon cette direction.

Cependant, les pertes par festons (mécanisme 2) et par piégeage (mécanisme 3) avec pertes sur les parois sont quand même très importantes dans cette structure. Elles sont en effet linéaires.

5

10

20

25

La ligne 11 représente les pertes des particules chargées qui viennent percuter le pôle d'un aimant ou la paroi située au droit dudit pôle (intensité magnétique maximale).

La ligne 12 représente les pertes des particules chargées qui viennent percuter la paroi entre deux pôles de polarité opposée (intensité magnétique minimale).

Les lignes 11 et 12 sont visibles en coupe transversale sur la figure 5.

Un deuxième mode de réalisation selon les figures 5 ou 6 met en œuvre une structure selon la figure 3.

Les lignes de champ 7 qui se rebouclent sur un même aimant permanent 3 interceptent la paroi 2 de l'enceinte 1. On a donc encore des pertes ponctuelles à la fois par les mécanismes 2 et 3.

En effet, les points 11 de la figure 3 correspondent à la fois aux festons, et à la fois à la trajectoires des particules piégées sur les lignes de champ 7 par le mécanisme 3. Par conséquent, des particules oscillant sur une ligne de champ se rebouclant sur un même aimant 3 ou arrivant sur un feston seront interceptées par la paroi 2 de l'enceinte et sont perdues pour le plasma.

Dans les structures en échiquier, les festons et points d'impact 12 des particules piégés sur les lignes 6 sont ponctuels et correspondent aussi aux centres géométriques des faces des aimants permanents. Les pertes sont donc relativement faibles par rapport au premier mode de réalisation.

Dans la configuration d'arrangement magnétique en échiquier, seules les particules chargées réfléchies par le mécanisme 1 sont effectivement confinées par le champ magnétique créé par la série d'aimants permanents.

Un troisième mode de réalisation selon les figures 5 ou 6 met en œuvre une structure selon la figure 4.

Il représente un cas intermédiaire des deux précédents, avec une efficacité de confinement intermédiaire aux deux autres.

En effet, il y a un rebouclement des lignes de champ sur l'arrière de l'aimant selon la direction 1. Il y a donc interception de particules chargées par la paroi de l'enceinte. Ces interceptions par le mécanisme 3 de particules par la paroi sont représentées par les croix 11.

Des pertes ponctuelles par le mécanisme 2 et 3 s'effectuent selon 10 la direction 2.

Outre les pertes de plasma décrites précédemment, les structures précédentes présentent des inconvénients.

Ils sont principalement au nombre de trois.

1/ Il est difficile de mettre en œuvre et de réaliser des structures de type « magnétron » fermées sur elles-mêmes, lesdites structures permettant d'éviter les pertes de plasma aux extrémités des structures continues.

2/ Il est difficile d'introduire dans une enceinte sous vide des structures magnétiques non rectilignes. Ainsi, seules certaines géométries d'enceinte sont susceptibles de recevoir des structures d'aimants simplifiées rectilignes comme des structures cylindriques ou parallélépipédiques.

3/ Les lignes d'aimants continues nécessitent de grandes quantités d'aimants permanents coûteux et lourds.

PRESENTATION DE L'INVENTION

5

20

25

30

L'invention propose de pallier ces inconvénients.

A cet effet, l'invention propose une structure magnétique multipolaire de confinement permettant de remédier à ces inconvénients tout en conférant une efficacité de confinement très élevée aux espèces chargées du plasma.

L'invention propose donc un dispositif de confinement d'un plasma dans une enceinte comportant des moyens pour créer un champ magnétique, lesdits moyens comportant une série d'aimants permanents aptes à créer un champ magnétique présentant au plasma une structure magnétique multipolaire alternée caractérisé en ce que les aimants sont aptes à confiner le plasma dans un grand volume, les aimants étant répartis de façon discontinue autour du volume et en ce que les aimants sont disposés à l'intérieur de l'enceinte, de façon éloignée des parois de l'enceinte par des tiges de support, les tiges de support s'étendant selon l'axe d'aimantation desdits aimants et étant disposées de façon centrée sur les pôles des aimants permanents.

- 10 L'invention est avantageusement complétée par les caractéristiques suivantes, prises seules ou en une quelconque de leur combinaison techniquement possible :
 - les tiges de support s'étendent perpendiculairement aux parois de l'enceinte ;
- 15 la série d'aimants permanents est en structure discontinue en échiquier ;
 - la série d'aimants permanents est en structure discontinue en ligne interrompue;
 - les aimants permanents ont une symétrie de révolution ;
 - les aimants permanents sont de forme cylindrique ;
- les tiges ont une faible section par rapport aux dimensions des aimants permanents;
 - les tiges de support sont des tubes, les aimants permanents étant situés à l'intérieur des tubes dans l'extrémité s'étendant dans l'enceinte, chaque aimant comportant sur sa face la plus en arrière par rapport à l'intérieur de l'enceinte une plaquette ou un disque d'un matériau à haute perméabilité magnétique;
 - le matériau est du fer doux ;

25

- il comporte des moyens de refroidissement des aimants permanents ;
- les moyens de refroidissement comportent un circuit de circulation aller retour d'un fluide autour de chaque aimant, ce circuit comportant une canalisation passant au centre de l'aimant;

- les aimants permanents sont compris dans une enveloppe extérieure de protection qui comporte un matériau amagnétique conducteur ou diélectrique;
- il comporte des moyens de production d'un plasma indépendants des moyens de confinement ;
 - la source de production de plasma est une structure à excitation par filaments thermo-émissifs ;
- la source de production de plasma est une structure à excitation par application au gaz d'une tension électrique de fréquence et de forme
 déterminées;
 - les moyens de production du plasma comportent des moyens aptes à appliquer au gaz un champ électrique micro-onde;
 - il comporte des moyens de production d'un plasma qui utilisent au moins une partie des moyens de confinement ;
- les moyens de production de plasma sont aptes à appliquer à la structure de confinement une tension électrique de fréquence et de forme déterminées;
 - les moyens de production de plasma comportent des moyens aptes à appliquer au gaz un champ électrique micro-onde.

PRESENTATION DES FIGURES

20

D'autres caractéristiques, buts et avantages de l'invention ressortiront de l'invention qui suit qui est purement illustrative et non limitative, et qui doit être lue en regard des dessins annexés sur lesquels :

- La figure 1, déjà commentée, représente la trajectoire d'une particule chargée entre deux points miroirs M situés en face d'aimants permanents ayant une polarité alternée;
 - -La figure 2, déjà commentée, représente une géométrie de structure multipolaire en ligne continue ;
- 30 La figure 3, déjà commentée, représente une structure multipolaire alternée en échiquier ;
 - La figure 4 , déjà commentée, représente une structure multipolaire en ligne discontinue ou interrompue ;

- La figure 5, déjà commentée, représente une coupe transversale d'une enceinte selon l'état de la technique utilisant les structures des figures 2 à 4;
- La figure 6, déjà commentée, est une représentation en coupe transversale d'un dispositif de confinement ayant une structure multipolaire en ligne continue;
- La figure 7 représente schématiquement une coupe transversale d'une structure générale d'un dispositif 1 de confinement selon l'invention ;
- La figure 8 est une représentation d'un détail de trois aimants permanents
 10 3;
 - La figure 9 représente schématiquement en coupe longitudinale la structure de moyens de refroidissement des aimants permanents ;
 - La figure 10 est une représentation d'une vue en coupe transversale d'une variante de l'invention comportant des matériaux à haute perméabilité magnétique où les aimants permanents sont à l'intérieur de tubes de support;
 - La figure 11 représente schématiquement de face une structure en échiquier selon l'invention, sur laquelle est représentée les festons ponctuels.

20

25

15

DESCRIPTION DE L'INVENTION

On se réfère aux figures 7 et 8 illustrant un mode de réalisation possible de l'invention.

La figure 7 représente la structure générale du dispositif de confinement selon une coupe transversale. Le dispositif comporte une enceinte 1, comportant une paroi 2 et une pluralité d'aimants permanents 3 disposés dans ladite enceinte 1. Un plasma 5 baigne l'intérieur de l'enceinte 1 et est confiné dans ladite enceinte.

La figure 8 est une représentation d'un détail de trois aimants 30 permanents 3.

Le plasma 5 peut être produit par une source plasma quelconque (non représentée) disposée à la périphérie de ou dans l'enceinte et opérant dans le domaine de pressions inférieures à quelques 10⁻² torr.

D'une part, le plasma 5 peut être produit par des moyens indépendants des moyens de confinement.

Le plasma 5 peut par exemple être produit par excitation par filament. Dans ce cas, des électrons sont émis par des filaments thermoémissifs intérieurs à la structure de confinement et polarisés négativement par rapport à l'enceinte et à la structure magnétique.

5

10

15

20

25

30

Pour générer le plasma à basse pression, on peut également utiliser des dispositifs permettant une application au gaz d'une tension électrique. La tension électrique peut avoir des formes et des fréquences variées en fonction des applications. La tension électrique peut par exemple être du type continue, continue pulsée, basse fréquence ou radio-fréquence.

L'excitation du plasma peut également être effectuée par l'application au gaz d'un champ électrique micro-onde. Le champ micro-onde peut être accompagné d'un champ magnétique, et par exemple être une excitation à la résonance cyclotronique électronique (RCE). Le champ micro-onde peut également ne pas être accompagné de champ magnétique, et on peut alors utiliser une excitation par onde de surface.

On peut aussi utiliser une excitation magnétron pour exciter le plasma.

D'autre part, il est également possible d'utiliser tout ou une partie des structures magnétiques de confinement pour exciter le plasma, soit par application à la structure d'une tension continue ou continue pulsée, d'une tension basse fréquence, ou radio-fréquence; soit par application de microondes, pour une excitation en champ magnétique (par exemple à la RCE) ou par onde de surface.

Ainsi, dans tous les cas, tout type d'excitation du plasma est envisageable, quel que soit la fréquence d'excitation et le mode d'excitation (RCE, décharge continue, décharge continue pulsée, décharge basse fréquence, décharge radio-fréquence, ondes de surface, décharge inductive, ou décharge magnétron ou RCE par exemple).

Le réacteur plasma décrit dans la présente demande comporte des moyens de mesure de pression et de diagnostic plasma souhaité (non représentés sur les figures). De même l'enceinte 1 est équipée de nombreux dispositifs d'introduction de gaz et de pompage de gaz, non représentés mais connus en eux-mêmes, permettant de maintenir la pression du gaz à ioniser à une valeur souhaitée qui peut être par exemple de 10⁻⁶ torr ou moins jusqu'aux pressions de l'ordre de 10⁻² torr par exemple suivant la nature du gaz et la fréquence d'excitation.

Les aimants 3 sont fixés à l'enceinte 1 par l'intermédiaire de tiges ou de tubes de support 4 centrés sur le pôle de chaque aimant et dans le prolongement de l'axe d'aimantation de chaque aimant.

Selon un mode de réalisation possible de l'invention, les supports 4 sont de très faible diamètre par rapport aux dimensions des aimants 3, et s'étendent perpendiculairement par rapport aux parois 2 de l'enceinte 1, desdites parois 2 vers l'intérieur de l'enceinte 1.

10

15

20

25

30

Selon un autre mode de réalisation de l'invention par exemple représenté à la figure 10, les supports 4 peuvent être sensiblement du même diamètre que les aimants. On prévoira alors des plaquettes ou des disques 18 à haute perméabilité magnétique.

De même selon un autre mode de réalisation non représenté sur les figures, les supports peuvent ne pas être perpendiculaires aux parois 2 de l'enceinte 1, mais disposés en biais par rapport aux parois.

Préférentiellement, les aimants permanents 3 possèdent des axes d'aimantation alternativement orientés d'un dispositif voisin à l'autre. On obtient alors une structure multipolaire avec une décroissance rapide, quasi exponentielle de l'intensité du champ magnétique en fonction de l'éloignement par rapport aux aimants.

Sur la figure 8, on a représenté par des traits pleins 6, 7 et pointillés 8 les lignes de champ magnétiques créées par les aimants permanents 3.

On comprend alors que le fait que les aimants permanents soient fixés à une distance des parois 2 de l'enceinte 1 telle que les parois 2 soient hors de la zone d'influence effective des aimants permet aux particules chargées issues du plasma 5, et piégées dans le champ magnétique sur les lignes 7, d'osciller librement, dans l'intervalle entre deux collisions

élastiques ou inélastiques entre particules, sans obstacle entre deux points miroirs M de même intensité de champ magnétique.

De plus, les lignes de champ 8 situées entre la paroi 2 et les aimants permanents 3 ont une probabilité très faible de piéger les particules chargées issues du plasma. En effet, les particules chargées sont réfléchies par les lignes de champ 6 situées du côté du plasma 5.

On voit donc qu'il y a une probabilité très faible pour qu'une particule chargée piégée dans une ligne de champ rencontre une paroi. Les pertes de plasma par collision avec les parois de l'enceinte sont donc réduites au minimum.

10

20

25

30

La figure 8 montre que les festons 12 d'un tel dispositif sur les faces présentées au plasma 5 sont identiques aux festons ponctuels d'une structure discontinue en échiquier (figure 3) ou en ligne interrompue (figure 4). Les pertes par festons sont donc moindres que dans une structure continue (figure 2). 15

Selon un premier mode de réalisation possible, les supports 4 ont des sections de très petites dimensions (faible diamètre par exemple). Par conséquent, les intersections avec les lignes 7 de champ magnétique sont réduites au minimum. On obtient ainsi idéalement une dimension d'intersection 13 par les particules oscillantes sur les lignes 7 sensiblement équivalente à une dimension d'un feston ponctuel 12.

Selon une solution de réalisation représentée aux figures 7 et 8, chaque aimant est constitué par un aimant de forme cylindrique présentant une aimantation axiale qui se trouve sensiblement située dans le prolongement de l'axe du support 4.

Le fait que les aimants présentent une symétrie de révolution autour de l'axe d'aimantation permet à l'aimant de représenter à lui tout seul une structure de type « magnétron » parfaite. De cette façon, les particules piégées sur des lignes de champ de forte intensité 7, c'est-à-dire se rebouclant sur le pôle opposé du même aimant, peuvent dériver sans obstacle autour de l'axe de l'aimant.

La forme cylindrique préférentielle présente l'avantage d'être plus simple à réaliser qu'un aimant de forme sphérique mais surtout plus simple à encapsuler dans une enveloppe étanche.

L'encapsulation dans une enveloppe étanche est souvent nécessaire, d'une part pour éviter les contaminations du plasma et/ou la corrosion des aimants par le plasma, et d'autre part, pour refroidir l'aimant en cas de besoin.

Bien entendu, les matériaux d'encapsulation et de fixation des aimants sont réalisés en matériaux amagnétiques. On pourra prendre des métaux non magnétiques par exemple.

Si un refroidissement des aimants permanents est nécessaire - c'est le cas notamment pour des applications avec des plasma denses -, il peut s'effectuer par une circulation double sens de fluide par l'intermédiaire du tube de fixation 4 de chaque aimant 3.

Un exemple d'une telle encapsulation est représentée à la figure 9. Selon ce mode de réalisation préféré, chaque support 4 peut être utilisé pour permettre le montage d'une canalisation 14 d'amenée d'un fluide de refroidissement. Elle s'étend dans un alésage central pratiqué dans l'aimant 3 selon l'axe d'aimantation de l'aimant. Cette canalisation 14 réalisée sous la forme d'un tube communique, à son extrémité, avec une enceinte 15 délimitée entre l'aimant 3 et une enveloppe 16 entourant à distance l'aimant.

L'enceinte 15 débouche dans une conduite 17 de retour du fluide de refroidissement délimitée entre la canalisation d'amenée 14 et le support 4.

L'aimant 3 se trouve ainsi encapsulé par l'enveloppe de protection 16 permettant la circulation d'un fluide de refroidissement autour de l'aimant 3. Par exemple, le matériau d'encapsulation de l'aimant et celui constituant les supports 4 sont réalisés en matériau amagnétique bon conducteur (métaux non magnétiques), mais ils peuvent également être entourés, pour des raisons de contamination, par des matériaux diélectriques sans nuire au bon fonctionnement du dispositif.

Une variante illustrée à la figure 10 du dispositif selon l'invention consiste à utiliser un tube de fixation et de support 4 de diamètre constant

5

10

. 15

25

30

sensiblement égal au diamètre de l'aimant permanent. Ce tube de fixation 4 permet à la fois de fixer et d'encapsuler les aimants. Chaque aimant permanent est situé dans l'extrémité du tube qui s'étend dans le plasma. On assure le refroidissement des aimants permanents si nécessaire.

Dans cette variante, on permet aux particules piégées d'osciller librement entre les points M.

Selon cette variante, chaque aimant permanent 3 présent dans un tube 4 présente sur sa face polaire la plus éloignée du plasma un matériau à haute perméabilité magnétique 18 - telle que par exemple une plaquette ou un disque de fer doux. Dans cette configuration, les électrons peuvent aussi osciller entre deux points miroir M. L'un des points M n'est plus situé en face du pôle de l'aimant, mais sur le côté, le long du support 4, tandis que l'autre point M reste en face du pôle. Ainsi, la présence de la plaquette ou du disque 18 disposée sur la face la plus externe par rapport au plasma 5, permet de modifier la position spatiale des points miroir M associés aux pôles de chaque aimant permanent 3.

De telles structures magnétiques présentent une grande efficacité de confinement du plasma, et peuvent être adaptées à des géométries d'enceinte très variées par exemple cylindriques comme représenté à la figure 7.

<u>AVANTAGES</u>

5

10

15

20

25

30

Les dispositifs décrits permettent d'obtenir une très grande efficacité de confinement du plasma.

En effet, ils minimisent les pertes en particules chargées par les différents mécanismes. En particulier, comme le représente la figure 11, les pertes sur les festons sont réduites. Dans la structure en échiquier utilisée dans les modes de réalisation possibles de l'invention, les lignes de champ 6 forment une barrière protectrice sur laquelle les particules viennent se réfléchir ou osciller. Sur la figure 11, les points 11 et 12 montrent les festons ponctuels. Ainsi, dans une telle structure, il n'y a en moyenne que deux festons ponctuels par aimant permanent, contrairement à toute une ligne de festons sur une structure continue.

En outre, chaque aimant permanent constitue une structure magnétron tridimensionnelle parfaite, de par sa symétrie de révolution, ce qui limite d'autant les pertes en particules chargées et assure de surcroît une stabilité parfaite au plasma.

Au surplus, les structures multidipolaires proposées par l'invention sont très faciles à mettre en œuvre. Elles ne nécessitent qu'un nombre très réduit d'aimants permanents par rapport à une structure continue en ligne, ce qui pour des enceintes de grand volume procure des gains importants de coût et de poids.

5

10

15

20

Les structures magnétiques multidipolaires proposées par l'invention utilisent des aimants de même nature (en ferrite de baryum strontium, en samarium-cobalt, en néodyme-fer-bore par exemple) et de même dimension (aimants unitaires de l'ordre du centimètre, distance entre aimants de quelques centimètres) que dans les structures multipolaires conventionnelles.

A titre d'exemples non limitatifs, une telle structure multidipolaire de confinement peut être réalisée avec des aimants samarium-cobalt avec un diamètre de 2 cm, et une longueur de 3 cm, disposés tous les 7 cm à la périphérie d'une enceinte cylindrique.

Le dispositif selon l'invention est avantageusement utilisé dans l'implantation ionique par immersion plasma (PBII ou Plasma Based Ion Implantation), la pulvérisation directe ou réactive assistée par plasma, la CVD (Chemical Vapor Depostion) assistée par plasma micro-onde, la gravure, voire les traitements thermo-chimiques.

On peut également citer leur application à la pulvérisation des matériaux magnétiques, les dépôts de diélectriques à forte permittivité, comme par exemple les oxydes de grille en micro électronique.

REVENDICATIONS.

1. Dispositif de confinement d'un plasma (5) dans une enceinte (1) comportant des moyens pour créer un champ magnétique, lesdits moyens comportant une série d'aimants permanents (3) aptes à créer un champ magnétique présentant au plasma une structure magnétique multipolaire alternée caractérisé en ce que les aimants (3) sont aptes à confiner le plasma dans un grand volume, les aimants étant répartis de façon discontinue autour du volume et en ce que les aimants (3) sont disposés à l'intérieur de l'enceinte, de façon éloignée des parois de l'enceinte par des tiges (4) de support, les tiges (4) de support s'étendant selon l'axe d'aimantation desdits aimants et étant disposées de façon centrée sur les pôles des aimants permanents.

15

10

5

 Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que les tiges de support (4) s'étendent perpendiculairement aux parois de l'enceinte.

20

3. Dispositif selon l'une des revendications 1 ou 2, caractérisé en ce que la série d'aimants permanents (3) est en structure discontinue en échiquier.

25

- 4. Dispositif selon l'une des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que la série d'aimants permanents (3) est en structure discontinue en ligne interrompue.
- 5. Dispositif selon l'une des revendications 1 à 4, caractérisé en ce que les aimants permanents (3) ont une symétrie de révolution.

30

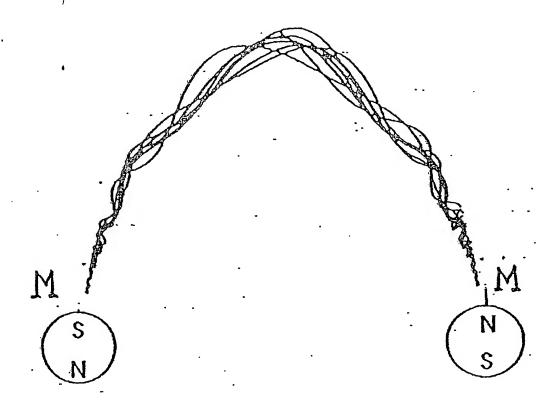
6. Dispositif selon l'une des revendications 1 à 5, caractérisé en ce que les aimants permanents sont de forme cylindrique.

- 7. Dispositif selon l'une des revendications 1 à 6, caractérisé en ce que les tiges ont une faible section par rapport aux dimensions des aimants permanents.
- 5 8. Dispositif selon l'une des revendications 1 à 6, caractérisé en ce que les tiges (4) de support sont des tubes, les aimants permanents étant situés à l'intérieur des tubes (4) dans l'extrémité s'étendant dans l'enceinte (1), chaque aimant comportant sur sa face la plus en arrière par rapport à l'intérieur de l'enceinte (1) une plaquette ou un disque (18) d'un matériau à haute perméabilité magnétique.
 - 9. Dispositif selon la revendication 8, caractérisé en ce que le matériau est du fer doux.
- 10. Dispositif selon l'une des revendications 1 à 9, caractérisé en ce qu'il comporte des moyens de refroidissement des aimants permanents (3).
- Dispositif selon la revendication 10, caractérisé en ce que les moyens de refroidissement comportent un circuit de circulation allerretour d'un fluide autour de chaque aimant, ce circuit comportant une canalisation passant au centre de l'aimant.
- 12. Dispositif selon l'une des revendication 1 à 11, caractérisé en ce que les aimants permanents sont compris dans une enveloppe extérieure de protection (16) qui comporte un matériau amagnétique conducteur ou diélectrique.
- 13. Dispositif selon l'une des revendications 1 à 12, caractérisé en ce qu'il comporte des moyens de production d'un plasma indépendants des moyens de confinement.

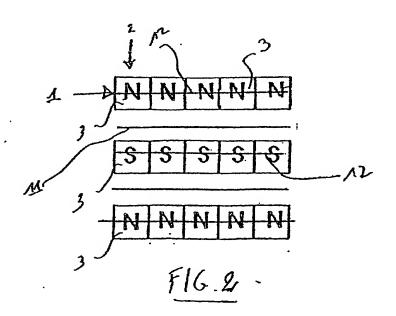
- 14. Dispositif selon la revendication 13, caractérisé en ce que la source de production de plasma est une structure à excitation par filaments thermo-émissifs.
- 5 15. Dispositif selon la revendication 13, caractérisé en ce que la source de production de plasma est une structure à excitation par application au gaz d'une tension électrique de fréquence et de forme déterminées pour une application souhaitée.
- 10 16. Dispositif selon la revendication 13, caractérisé en ce que les moyens de production du plasma comportent des moyens aptes à appliquer au gaz un champ électrique micro-onde.
- 17. Dispositif selon l'une des revendications 1 à 12, caractérisé en ce
 qu'il comporte des moyens de production d'un plasma qui utilisent au moins une partie des moyens de confinement.

20

- 18. Dispositif selon la revendication 17, caractérisé en ce que les moyens de production de plasma sont aptes à appliquer à la structure de confinement une tension électrique de fréquence et de forme déterminées pour une application souhaitée.
- 19. Dispositif selon la revendication 17, caractérisé en ce que les moyens de production comportent des moyens aptes à appliquer au gaz un champ électrique micro-onde.



F16.1



THE CLIPSE

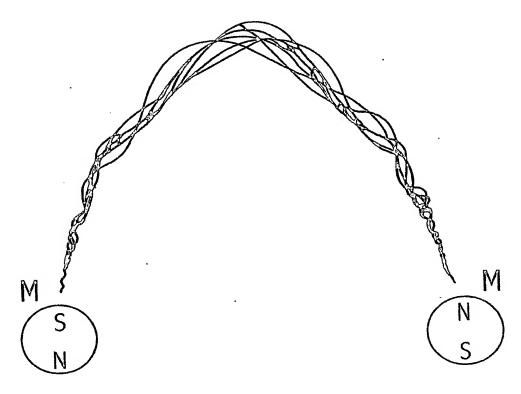
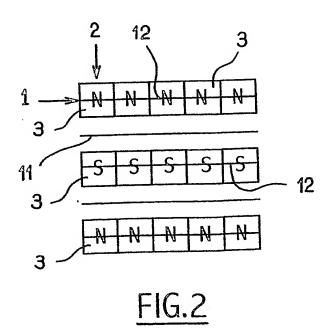
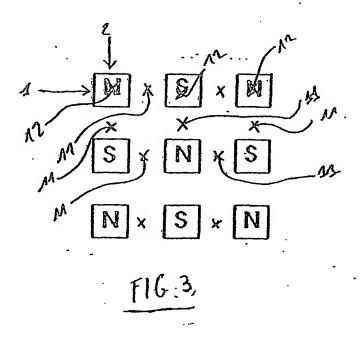
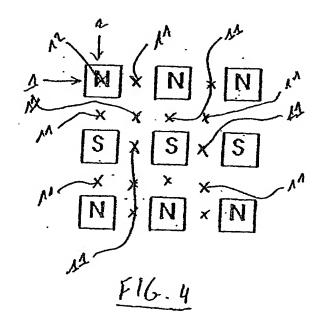


FIG.1







STATE CONSTRUCT

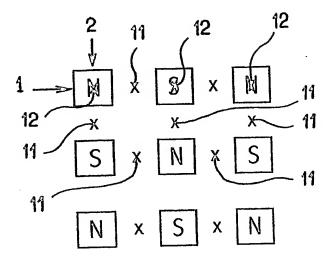


FIG.3

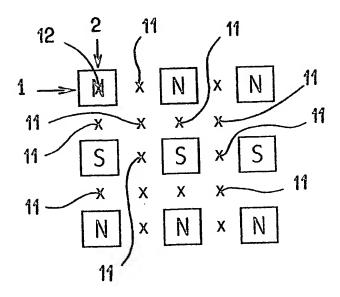
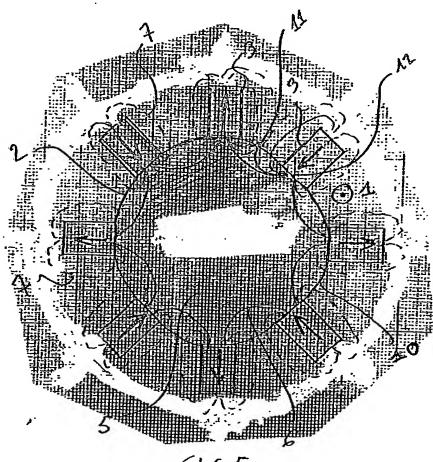
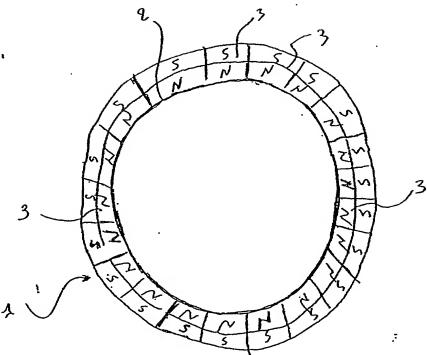


FIG.4

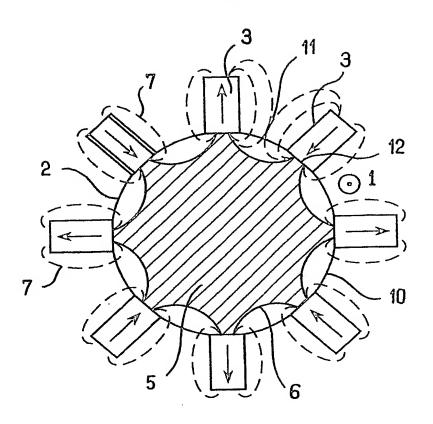


F16.5.



THE REGISEAU
THE COMMENT

F16.6.



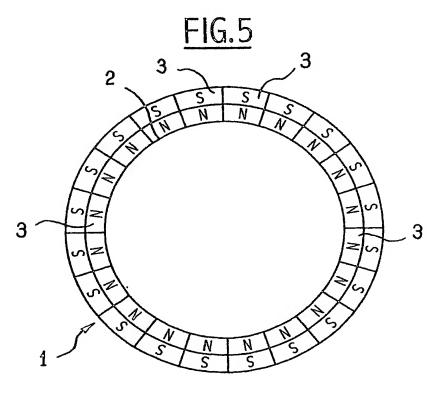
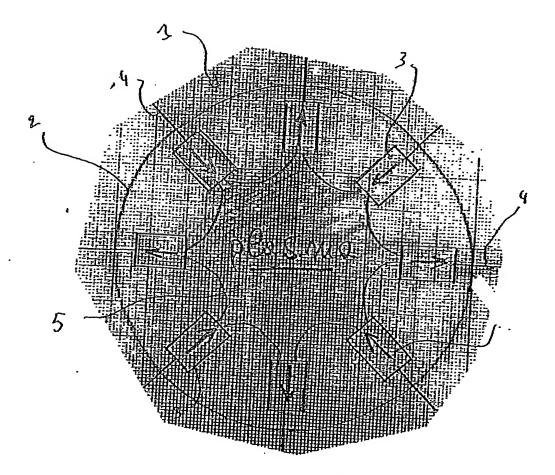
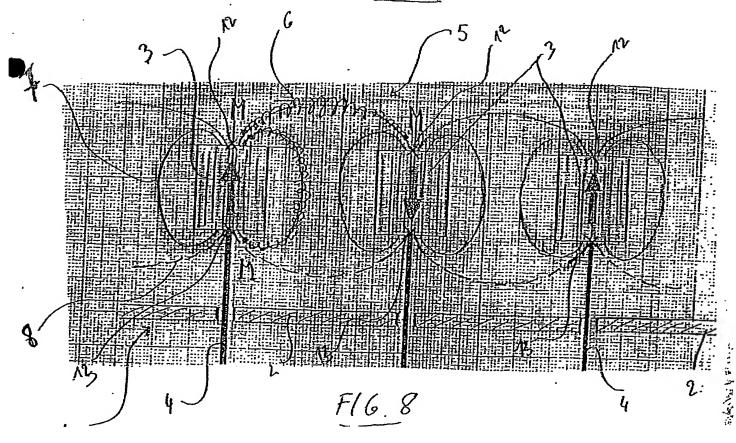


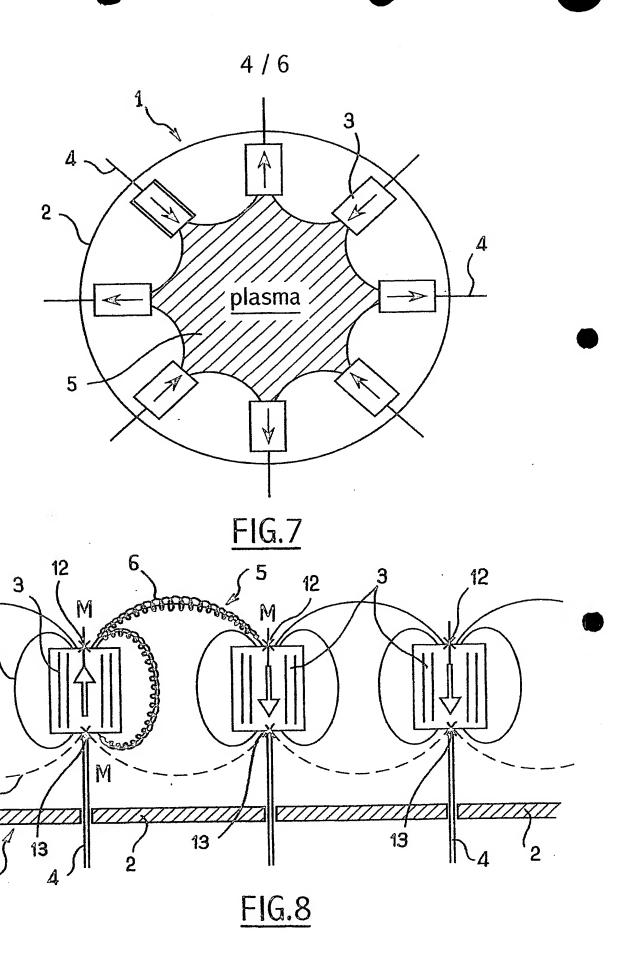
FIG.6



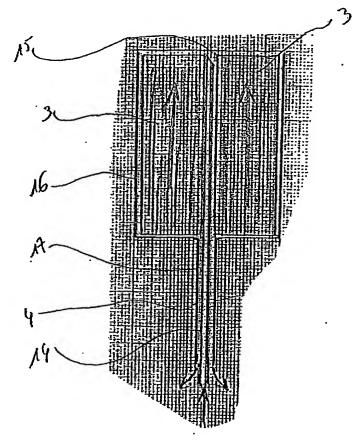
F16.4.

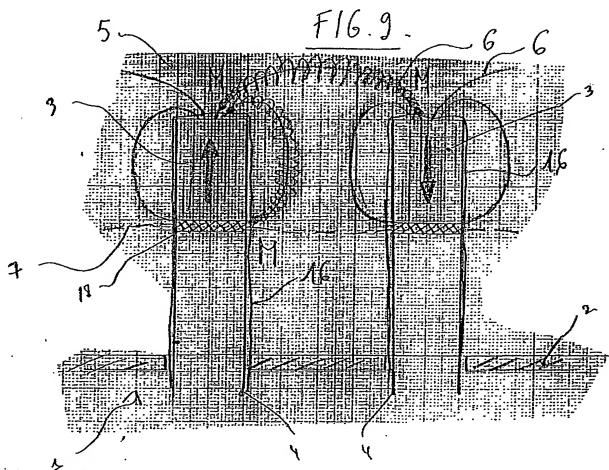


The second

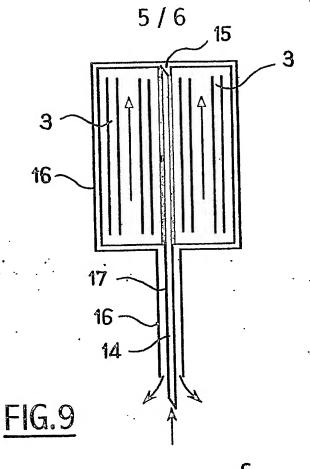


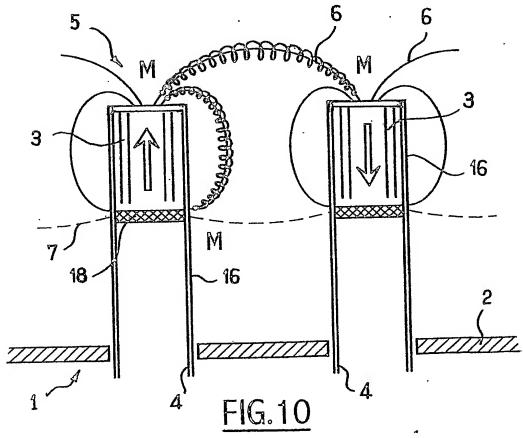


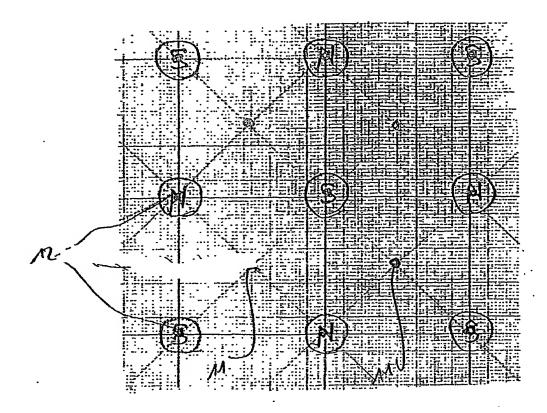




F16.10.







F16.M.



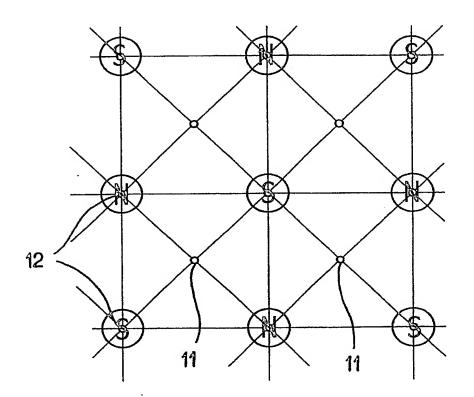


FIG.11



CERTIFICAT D'UTILITÉ

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI



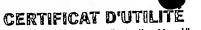
DÉPARTEMENT DES BREVETS

26 bis, rue de Saint Pétersbourg 75800 Paris Cedex 08

DÉSIGNATION D'INVENTEUR(S) Page N° 1 (Si le demandeur n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur)

Héphone : 33 (1) 53 (04 53 04 Télécopie : 33 (1) 42 94	Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire 08 113 W /3003
Vos références (facultatif)	pour ce dossier	229521 AV
N° D'ENREGIST	REMENT NATIONAL	0203000
TITRE DE L'INV	ENTION (200 caractères ou c	
DISPOSITIF I	DE CONFINEMENT DE	PLASMA.
LE(S) DEMAND	EUR(S) :	
CENTRE NAT	I'IONAL DE LA RECHE	RCHE SCIENTIFIQUE (CNRS): 3, rue Michel Ange, 75016 PARIS - FRANCE
DESIGNE(NT)	EN TANT OU'INVENTEU	R(S) : (Indiquez en haut à droite «Page N° 1/1» S'il y a plus de trois inventeurs,
utilisez un for	mulaire identique et num	érotez chaque page en indiquant le nombre total de pages).
Nom		
Prénoms		LACOSTE Ana
Adresse	Rue	44, avenue Général Leclerc 38950 St MARTIN LE VINOUX, FRANCE
	Code postal et ville	38930 SI MARTIN LE VINOUX, FRANCE
Société d'appar	tenance (facultatif)	
Nom		ARNAL Yves Alban-Marie
Prénoms		
Adresse	Rue	5, allée de la Treille , 38320 POISAT FRANCE
	Code postal et ville	JOSEP TOTAL
Société d'appar	tenance (facultatif)	
Nom		BECHU Stéphane
Prénoms		
Adresse	Rue	19, rue Jean-Jaurès
	Code postal et ville	01200 BELLEGARDE SUR VALSERAIE FRANCE
Société d'appar	tenance <i>(facultatif</i>)	
DATE ET SIGN DU (DES) DEN OU DU MAND. (Nopret quali	//ANDEUR(S)	
H/)	92-1001	







Code de la propriété intellectuelle - Livre VI

DÉPARTEMENT DES BREVETS

26 bis, rue de Saint Pétersbourg

75800 Paris Cedex 08

DÉSIGNATION D'INVENTEUR(S) Page N°2...2... (Si le demandeur n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur)

éphone : 33 (1) 53 0	4 53 04 Telecopie : 33 (1) 42 94 6	Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire 08 11 W/300301
facultatif)	pour ce.dossier	
N° D'ENREGIST	REMENT NATIONAL	0203800
TITRE DE L'INVI	ENTION (200 caractères ou e	
DISPOSITIF D	E CONFINEMENT DE	PLASMA.
LE(S) DEMAND	EUR(S) :	
	TO TORY OWNWEATEN	RCHE SCIENTIFIQUE (CNRS): 3, rue Michel Ange, 75016 PARIS - FRANCE R(S): (Indiquez en haut à droite «Page N° 1/1» S'il y a plus de trois inventeurs,
utilisez un fori	mulaire identique et nume	erotez chaque page en moiquant le nombre teat 20 pages,
Nom		PELLETIER Jacques
Prénoms	1	
Adresse	Rue	8, Chemin du Fort Le Mûrier
	Code postal et ville	18400 ST MARTIN D'HERES FRANCE
Société d'appar	tenance (facultatif)	
Nom		
Prénoms		
Adresse	Rue	
	Code postal et ville	
Société d'appar	rtenance (facultatif)	
Nom		
Prénoms		
Adresse	Rue	
	Code postal et ville	
Société d'appa	rtenance (facultatif)	
DATE ET SIGI DU (DES) DEI OU DU MAND (Nom et qual	MANDEUR(S)	
11/	92-1001	the same faites à ce formulaire

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER: _____

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.